Квантовый самосогласованный расчет дифференциальной емкости полупроводниковой пленки

© Д.Е. Цуриков [¶], А.М. Яфясов ^{¶¶}

Санкт-Петербургский государственный университет (физический факультет), 198504 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 7 июня 2012 г. Принята к печати 13 декабря 2012 г.)

В рамках самосогласованного решения уравнений Шрёдингера и Пуассона предложена быстрая схема вычисления поверхностной дифференциальной емкости полупроводниковой пленки в случае омического контакта на тыльной стороне. Метод рассмотрен на примере германия. Сравнение с результатами феноменологического расчета выявило специфику влияния эффектов размерного квантования на вольтфарадную характеристику пленки.

1. Введение

Современные технологии позволяют формировать полупроводники с практически идеальной поверхностью (однородной, без поверхностных состояний и дефектов). В совокупности с высокоточными измерениями электрофизичкских характеристик это дает возможность детально исследовать явление размерного квантования в области пространственного заряда (ОПЗ). В связи с этим возрастают требования к точности сопровождающих эксперимент расчетов.

История расчетов ОПЗ полупроводников с учетом размерного квантования носителей заряда насчитывает более 40 лет [1-11]. Исторически первый метод модельных потенциалов [1,5-7] прост в реализации, но имеет низкую точность. Поэтому он малопригоден для количественного анализа результатов современных экспериментов. Для этих целей предпочтителен подход, основанный на самосогласованном решении уравнений Шрёдингера и Пуассона [2-11]. Однако его применение в режиме реального времени, в частности при автоматизированном измерении дифференциальной емкости в зависимости от поверхностного потенциала, имеет ряд трудностей. Они связаны с низкой скоростью расчетов и с неустойчивостью схемы в широких диапазонах значений параметров задачи. Для решения этих вопросов нужны специальные алгоритмы вычислений на основе оптимальных численных методов.

В данной работе предложена быстрая устойчивая схема квантового самосогласованного расчета вольтфарадной характеристики (ВФХ) полупроводниковой пленки. Она позволяет корректно проследить специфику перехода от квантовой теории ОПЗ [1–13] к классической [12,14,15]. Подход проиллюстрирован расчетами и сравнительным анализом ВФХ пленки германия.

2. Постановка задачи

Рассмотрим однородно легированную полупроводниковую пленку, предполагая отсутствие поверхностных

¶ E-mail: DavydTsurikov@mail.ru

состояний, полную ионизацию примесей и омический контакт с металлом на тыльной стороне (рис. 1). Найдем ее поверхностную дифференциальную емкость *C*:

$$C = -dQ/dV_S,\tag{1}$$

$$Q = \int_{0}^{z} dz \rho(z), \qquad (2)$$

$$\rho(z) = e_0 n_d - e_0 n_a + e_0 n^+(z) - e_0 n^-(z), \qquad (3)$$

где Q — поверхностная плотность заряда, V_S — электростатический потенциал на лицевой стороне пленки, ρ — объемная плотность заряда, e_0 — элементарный заряд, n_d , n_a — концентрации ионизованных донорной и акцепторной примесей соответственно, n^{\pm} — концентрации носителей заряда (здесь и везде далее верхний индекс «–» отвечает электронам, «+» — дыркам).

Используя классическое приближение для описания движения носителей заряда в плоскости пленки, выражения для их концентраций запишем в виде [4]

$$n^{-}(z) = n_{\parallel}^{-} \sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_{\perp n}^{-}(z)|^{2} F_{0} \left(\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{C} - E_{\perp n}^{-}}{k_{0} T} \right), \qquad (4)$$

$$n^{+}(z) = n_{\parallel}^{+} \sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_{\perp n}^{+}(z)|^{2} F_{0}\left(\frac{E_{V} - E_{F} - E_{\perp n}^{+}}{k_{0}T}\right), \quad (5)$$

$$n_{\parallel}^{\pm} = \frac{m_{\parallel}^{\pm} k_0 T}{\pi \hbar^2},\tag{6}$$

где m_{\parallel}^{\pm} — эффективные массы носителей заряда в плоскости пленки, k_0 — постоянная Больцмана,



Рис. 1. Условное изображение полупроводниковой пленки: *I* — тыльная сторона, *2* — лицевая сторона, *L* — толщина.

^{¶¶} E-mail: yafyasov@bk.ru

T — температура кристалла, \hbar — постоянная Планка, $F_0(\eta) = \ln(1 + e^{\eta})$ — интеграл Ферми–Дирака порядка 0, E_F — уровень Ферми, E_C и E_V — энергии краев зоны проводимости и валентной зоны соответственно. Волновые функции носителей заряда φ_{\perp}^{\pm} и их уровни энергии E_{\perp}^{\pm} можно найти из уравнения Шрёдингера:

$$\begin{cases} \left[-\frac{\hbar^2}{2m_{\perp}^{\pm}} \partial_z^2 + U^{\pm}(z) \right] \varphi_{\perp}^{\pm}(z) = E_{\perp}^{\pm} \varphi_{\perp}^{\pm}(z), & z \in (0, L), \\ \varphi_{\perp}^{\pm}(0) = \varphi_{\perp}^{\pm}(L) = 0, \end{cases}$$
(7)

$$U^{\pm} = \pm e_0 V, \tag{8}$$

где m_{\perp}^{\pm} — эффективные массы носителей заряда перпендикулярно пленке, V — электростатический потенциал.

Согласно (4)–(8),
$$n^{\pm}$$
 неявно зависят от потенциала V
Его можно найти из уравнения Пуассона:

$$\begin{cases} V''(z) = -\frac{1}{\epsilon\epsilon_0}\rho(z), & z \in (0, L), \\ V(0) = V_S, & V(L) = 0, \end{cases}$$
(9)

где ϵ — диэлектрическая проницаемость пленки, ϵ_0 — электрическая постоянная. Потенциал является самосогласованным, так как он определяет пространственное распределение концентраций носителей заряда в пленке и при этом зависит от него.

Самосогласованный расчет потенциала V осуществляется следующим образом. На первой итерации задается потенциал V_1 как результат численного решения уравнения Пуассона в классическом приближении [15]. На основе V_1 вычисляется объемная плотность заряда ρ_1 согласно (3)–(7). Следующие итерации организуются по схеме

$$V_{n+1} = \frac{1}{2}(V_n + \tilde{V}_{n+1}), \qquad (10)$$

$$\begin{cases} \tilde{V}_{n+1}''(z) = -\frac{1}{\epsilon\epsilon_0} \rho_n(z), & z \in (0, L), \\ \tilde{V}_{n+1}(0) = V_S, & \tilde{V}_{n+1}(L) = 0. \end{cases}$$
(11)

Интегрируя правую часть уравнения (11) с учетом граничных условий, получим

$$\tilde{V}_{n+1}(z) = V_S + \left[\int_{0}^{L} dz_1 \mathscr{E}_n(z_1) - V_S\right] \frac{z}{L} - \int_{0}^{z} dz_1 \mathscr{E}_n(z_1),$$
(12)

$$\mathscr{E}_n(z) = \frac{1}{\epsilon\epsilon_0} \int_0^z dz_1 \rho_n(z_1).$$
(13)

3. Специфика квантового самосогласованного расчета

Перед расчетом ВФХ найдем уровень Ферми в пленке из уравнения электронейтральности:

$$Q = 0, \quad V_S = 0.$$
 (14)

С учетом (2)-(5) и нормировки волновых функций

$$\int_{0}^{L} dz |\varphi_{\perp n}^{\pm}(z)|^{2} = 1, \quad n \in \mathbb{N},$$
(15)

поверхностная плотность заряда примет вид

$$Q = e_0(n_d - n_a)L + e_0 n_{\parallel}^+ \sum_{n=1}^{\infty} F_0\left(\frac{E_V - E_F - E_{\perp n}^+}{k_0 T}\right) - e_0 n_{\parallel}^- \sum_{n=1}^{\infty} F_0\left(\frac{E_F - E_C - E_{\perp n}^-}{k_0 T}\right).$$
(16)

Согласно (16), уравнение (14) является самосогласованным: при $V_S = 0$ потенциал в пленке отличен от нуля. Это приводит к изгибу зон [1] и отклонению уровней энергии $\{E_{\perp n}^{\pm}\}_{n=1}^{\infty}$ от уровней энергии прямоугольной потенциальной ямы:

$$\tilde{E}_{\perp n}^{\pm} = \frac{\hbar^2}{2m_{\perp}^{\pm}} \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$
(17)

Как показали расчеты, на положение уровня Ферми этот эффект влияет слабо. Поэтому, полагая $E_{\perp n}^{\pm} \approx \tilde{E}_{\perp n}^{\pm}$, с учетом (14), (16) и (17) для поиска E_F можно использовать приближенное уравнение электронейтральности:

$$0 = e_0 (n_d - n_a) L + e_0 n_{\parallel}^+ \sum_{n=1}^{\infty} F_0 \left(\frac{E_V - E_F - \tilde{E}_{\perp n}^+}{k_0 T} \right) - e_0 n_{\parallel}^- \sum_{n=1}^{\infty} F_0 \left(\frac{E_F - E_C - \tilde{E}_{\perp n}^-}{k_0 T} \right).$$
(18)

Оно позволяет повысить скорость вычислений в силу отсутствия самосогласования при поиске уровней энергии.

В численных расчетах для концентраций носителей заряда вместо выражений (4) и (5) используются

$$n_{K}^{-}(z) = n_{\parallel}^{-} \sum_{n=1}^{K} |\varphi_{\perp n}^{-}(z)|^{2} F_{0}\left(\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{C} - E_{\perp n}^{-}}{k_{0}T}\right), \quad (19)$$

$$n_{K}^{+}(z) = n_{\parallel}^{+} \sum_{n=1}^{K} |\varphi_{\perp n}^{+}(z)|^{2} F_{0}\left(\frac{E_{V} - E_{F} - E_{\perp n}^{+}}{k_{0}T}\right).$$
(20)

Верхние пределы суммирования находим, удваивая *K*, пока не будет выполнено условие

$$|Q_{K}^{\pm} - Q_{K/2}^{\pm}| < \delta_{Q} |Q_{K/2}^{\pm}|, \qquad (21)$$

$$Q_{K}^{\pm} = \pm e_{0} \int_{0}^{L} dz n_{K}^{\pm}(z), \qquad (22)$$

где δ_Q — заданная относительная погрешность вычисления поверхностной плотности заряда. Конечное значение *К* может быть различным для электронов и дырок. Это связано с особенностями расположения их уровней

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 9

энергии при данном потенциале. Предложенный подход позволяет ограничиться расчетом только тех уровней энергии, которые существенно влияют на заряд в ОПЗ. В результате выражение для объемной плотности заряда в (13) примет вид

$$\rho \approx e_0(n_d - n_a) + e_0 n_K^+ - e_0 n_K^-.$$
(23)

По аналогии с (21) запишем условие выхода их самосогласованной процедуры как

$$|Q_M - Q_{M-1}| < \delta_Q |Q_{M-1}|, \tag{24}$$

где Q_M — поверхностная плотность заряда, рассчитанная на M-й итерации.

Расчет уровней энергии носителей заряда

4.1. Безразмерная задача

В основе самосогласованной процедуры расчета лежит численное решение задачи (7). Запишем ее в безразмерном виде. Введем безразмерную координату и толщину пленки,

$$\xi = z/L_{\rm D}, \quad \lambda = L/L_{\rm D}, \tag{25}$$

где L_D — длина дебаевского экранирования [15], энергию и потенциал,

$$\varepsilon = 2m_{\perp}^{\pm}\hbar^{-2}L_{\rm D}^{2}E_{\perp}^{\pm},$$

$$\upsilon(\xi) = 2m_{\perp}^{\pm}\hbar^{-2}L_{\rm D}^{2}U^{\pm}(L_{\rm D}\xi),$$
 (26)

волновые функции ψ с нормировкой

$$\int_{0}^{\lambda} d\xi |\psi(\xi)|^{2} = 1.$$
 (27)

Из (15), (25) и (27) получим

$$\varphi_{\perp}^{\pm}(z) = L_{\rm D}^{-1/2} \psi(z/L_{\rm D}).$$
 (28)

Согласно (25), имеем

$$\partial_z = L_{\rm D}^{-1} \partial_{\xi}. \tag{29}$$

Тогда безразмерная задача на собственные функции и собственные значения примет вид

$$\begin{cases} [-\partial_{\xi}^{2} + \upsilon(\xi)]\psi(\xi) = \varepsilon\psi(\xi), & \xi \in (0,\lambda), \\ \psi(0) = 0, & \psi(\lambda) = 0. \end{cases}$$
(30)

Задачу (30) будем решать методом стрельбы [16]. Он состоит в решении задачи Коши, поставленной на одном конце интервала $(0, \lambda)$, и поиске таких значений ε , при которых выполняется граничное условие на другом конце. Потенциал в (30) является монотонным. Стрельба со стороны его максимального значения υ_{max} в сторону минимального υ_{min} даст лучшее выполнение граничного условия. Перед переходом от (7) к (30) применим правило смены системы координат:

$$z \mapsto \begin{cases} z, & \pm V_S \le 0, \\ L - z, & \pm V_S > 0. \end{cases}$$
(31)

Тогда потенциал в (30) всегда будет возрастающим и стрельба будет из точки $\xi = \lambda$ в точку $\xi = 0$ (справа налево).

4.2. Численное решение задачи Коши

Рассмотрим состояния носителя заряда с энергией $\upsilon_{\min} < \varepsilon < \upsilon_{\max}$. Их волновые функции под потенциальным барьером быстро спадают и вблизи точки $\xi = \lambda$ могут оказаться пренебрежимо малыми. Организуем алгоритм формального смещения правой границы и выбора на ней значения производной волновой функции в задаче Коши. Это позволит повысить скорость и устойчивость расчетов.

В основе подхода лежит аппроксимация волновой функции в интервале под барьером $[\xi_+, \lambda]$, где ξ_+ — правая точка поворота: $\upsilon(\xi_+) = \tilde{\varepsilon}$, $\tilde{\varepsilon}$ — начальное приближение к собственному значению ε . Для оценки ее скорости спада усредним нулевое квазиклассическое приближение [17]:

$$\psi(\xi) = D \operatorname{sh}(\bar{\kappa}[\lambda - \xi]), \qquad (32)$$

$$\bar{\kappa} = \frac{1}{\lambda - \xi_+} \int_{\xi_+}^{\lambda} d\xi \kappa(\xi), \qquad (33)$$

$$\kappa(\xi) = \sqrt{\upsilon(\xi) - \tilde{\varepsilon}}.$$
 (34)

Положив $\tilde{\psi}'(\xi_+) = 1$, найдем неизвестную константу *D*, и из (32) получим

$$\tilde{\psi}'(\lambda) = \operatorname{ch}^{-1}(\bar{\kappa}[\lambda - \xi_+]).$$
(35)

Условием большой толщины положим

$$\bar{\kappa}[\lambda - \xi_+] > \frac{1}{2}\Delta_{\exp},\tag{36}$$

где Δ_{exp} — максимальный показатель экспоненты для данной ЭВМ, коэффициент 1/2 получен эмпирически. При выполнении (36) новое положение правой границы $\lambda_{<}$ найдем из уравнения

$$\bar{\kappa}[\lambda_{<}-\xi_{+}] = \frac{1}{2}\Delta_{\exp}.$$
(37)

Тогда для выбора λ_< получим правило

$$\lambda_{<} = \begin{cases} \lambda, & \bar{\kappa}[\lambda - \xi_{+}] \leq \frac{1}{2}\Delta_{\exp}, \\ \xi_{+} + \frac{1}{2}\Delta_{\exp}/\bar{\kappa}, & \bar{\kappa}[\lambda - \xi_{+}] > \frac{1}{2}\Delta_{\exp}. \end{cases}$$
(38)

При этом полагаем

$$\forall \xi \in [\lambda_{<}, \lambda], \quad \psi(\xi) = 0. \tag{39}$$

Таким образом, для решения задачи (30) методом стрельбы имеем задачу Коши:

$$\begin{cases} [-\partial_{\xi}^{2} + \upsilon(\xi)]\psi(\xi) = \varepsilon\psi(\xi), & \xi \in (0, \lambda_{<}), \\ \psi(\lambda_{<}) = 0, & \psi'(\lambda_{<}) = \mathrm{ch}^{-1}(\bar{\kappa}_{<}[\lambda_{<} - \xi_{+}]), \end{cases}$$
(40)

$$\bar{\kappa}_{<} = \frac{1}{\lambda_{<} - \xi_{+}} \int_{\xi_{+}}^{\lambda_{<}} d\xi \kappa(\xi).$$
(41)

При $v_{\min} < \varepsilon < v_{\max}$ выбираем предварительно положение правой границы согласно (38) с учетом (33) и (34), а при $v_{\max} \le \varepsilon$ полагаем в (40) $\lambda_{<} = \lambda$ и $\psi'(\lambda_{<}) = 1$.

Для повышения скорости решения задачи Коши выберем сетку из N узлов $\{\xi_n\}_{n=1}^N \subset [0, \lambda_<]$ с постоянным шагом h

$$\xi_n - \xi_{n-1} = h, \quad n = 2, \dots, N.$$
 (42)

Корректный вид волновых функций в широком диапазоне значений ε (устойчивость) обеспечит алгоритм Верле в скоростной форме. При стрельбе справа налево в задаче (40) на правой границе сетки имеем

$$\psi_N = 0, \quad \psi'_N = \operatorname{ch}^{-1}(\bar{\kappa}_<[\lambda_< -\xi_+]),$$

 $\psi''_N = (\upsilon_N - \varepsilon)\psi_N = 0,$ (43)

а значения функции и ее производных в прочих узлах сетки вплоть до левой границы находим последовательно по схеме

$$\psi_{n-1} = \psi_n - \psi'_n h + \frac{1}{2} \psi''_n h^2 \rightarrow$$

$$\psi''_{n-1} = (\upsilon_{n-1} - \varepsilon) \psi_{n-1} \rightarrow$$

$$\psi'_{n-1} = \psi'_n - \frac{1}{2} (\psi''_{n-1} + \psi''_n) h, \qquad (44)$$

где $\psi_n = \psi(\xi_n), \upsilon_n = \upsilon(\xi_n).$

4.3. Поиск уровней энергии

В методе стрельбы следует найти нули $\psi(0)$ как функции параметра ε : $\{\varepsilon_n\}_{n=1}^{\infty}$. Для их быстрого поиска получим приближения к ним $\{\tilde{\varepsilon}_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Из квазиклассического условия квантования [17] найдем $\{\tilde{\varepsilon}_n\}_{n=1}^3$:

$$\int_{0}^{\zeta_{+}} d\xi \sqrt{\tilde{\varepsilon}_{n} - \upsilon(\xi)} = \pi n - \pi/4, \quad n = 1, 2, 3.$$
 (45)

Уравнение (45) — задача на поиск нуля функции, у которой он только один. Его можно легко найти: $\tilde{\epsilon}_1 \in (\upsilon_{\min}, \upsilon_{\max} + \pi^2/\lambda^2]$; для $\tilde{\epsilon}_2$ и $\tilde{\epsilon}_3$ начальные приближения есть $\tilde{\epsilon}_1$ и $\tilde{\epsilon}_2$ соответственно. Для расчета $\{\tilde{\varepsilon}_n\}_{n=4}^{\infty}$ экстраполируем ε как функцию квантового числа *n* по известным ε_{n-3} , ε_{n-2} , ε_{n-1} в область следующего уровня энергии:

$$\tilde{\varepsilon}_n = A + Bn + Cn^2. \tag{46}$$

Записав (46) для ε_{n-3} , ε_{n-2} , ε_{n-1} , найдем неизвестные коэффициенты и получим

$$\tilde{\varepsilon}_{n} = \varepsilon_{n-1} + B + C(2n-1), \quad n > 3,$$

$$B = \left(\frac{5}{2} - n\right)(\varepsilon_{n-1} - \varepsilon_{n-2}) + \left(n - \frac{3}{2}\right)(\varepsilon_{n-2} - \varepsilon_{n-3}),$$

$$C = \frac{1}{2}(\varepsilon_{n-1} - 2\varepsilon_{n-2} + \varepsilon_{n-3}). \quad (47)$$

С ростом *n* точность локализации (47) повышается, так как зависимость энергии от квантового числа стремится к параболической.

Таким образом, схема решения задачи (7) состоит в следующем:

 с учетом правила (31) переход от размерной задачи (7) к безразмерной (30) согласно (25)–(29);

— локализация уровней энергии посредством (45),
 (47);

— уточнение их положения с помощью метода Ньютона, примененного к методу стрельбы в задаче (40);

— восстановление размерных уровней энергии и волновых функций на основе безразмерных согласно (26), (28) с учетом нормировки (27) и правила (31).

5. Вольт-фарадные характеристики германиевой пленки

В последние годы гетеронаноструктуры Ge/Si являются предметом интенсивного исследования. Это связано с возможностью их применения в оптоэлектронике, основанной на кремниевой технологии [18], для создания светодиодов в диапазоне 1.30–1.55 мкм и лазерных диодов [19]. Поэтому наряду с кремнием германий представляет особый интерес для современной полупроводниковой техники.

Применим предложенную самосогласованную процедуру для расчета ВФХ германиевой пленки (111) при T = 300 К: $\epsilon = 16.2$, $E_g = 0.661$ эВ, $m_{\parallel}^- = 1.440m_0$, $m_{\perp}^- = 0.0815m_0$, $m_{\parallel}^+ = 0.350m_0$, $m_{\perp}^+ = 0.350m_0$, где m_0 масса свободного электрона [20]. Примеси полагаем полностью ионизованными.

Используемые эффективные массы носителей заряда согласно выражению

$$m^{\pm} = \sqrt[3]{(m^{\pm}_{\parallel})^2 m^{\pm}_{\perp}} \tag{48}$$

находятся в соответствии с эффективными массами, взятыми в работе [15]. Это позволяет провести сравнительный анализ ВФХ, полученных при классическом и квантовом самосогласованном описании ОПЗ. Для интерпретации результатов введем понятие тепловой длины волны носителей заряда:

$$L_{\perp}^{\pm} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \hbar^2}{m_{\perp}^{\pm} k_0 T}}.$$
 (49)

Здесь ее численные значения следующие:

$$L_{\perp}^{-} = 2.67 \cdot 10^{-8} \,\mathrm{m}, \quad L_{\perp}^{+} = 1.29 \cdot 10^{-8} \,\mathrm{m}.$$
 (50)

Учтем значение постоянной решетки германия

$$L_{\rm lat} = 5.65 \cdot 10^{-10} \,\mathrm{m},\tag{51}$$

так как условие применимости зонной модели для пленки имеет вид

$$L \gg L_{\text{lat}}.$$
 (52)

Характерные длины приближенно соотносятся друг с другом как

$$L_{\perp}^{-} \approx 2L_{\perp}^{+}, \quad L_{\text{lat}} \approx 0.02L_{\perp}^{-}.$$
 (53)

Поскольку существенное влияние эффектов размерного квантования на ВФХ можно ожидать при $L \sim L_{\perp}^{\pm}$, с



Рис. 2. Вольт-фарадные характеристики германия: a — собственный германий $(n_a = 0, n_d = 0); b$ — *п*-германий $(n_d = 10^{22} \text{ m}^{-3}, n_a = 0). 1$ — классический расчет при $L = \infty, 2$ — классический расчет при $L = L_{\perp}^-, 3$ — квантовый самосогласованный расчет при $L = L_{\perp}^-.$

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 9



Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики германия: a — собственный германий ($n_a = 0$, $n_d = 0$); b — n-германий ($n_d = 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $n_a = 0$). 1 — классический расчет при $L = \infty$, 2 — классический расчет при $L = 0.2L_{\perp}^{-}$, 3 — квантовый самосогласованный расчет при $L = 0.2L_{\perp}^{-}$.

учетом (52) и (53) рассмотрим в расчетах диапазон толщин пленки

$$0.2L_{\perp}^{-} \le L \le L_{\perp}^{-}.$$
 (54)

На рис. 2, *а* и рис. 3, *а* представлены ВФХ собственного германия, полученные в результате классического и квантового самосогласованного расчета. Из них видно, что провал поверхностной дифференциальной емкости в окрестности $V_S = 0$ вплоть до $L \sim L_{\perp}^-$ хорошо описывается в рамках классической модели. Эффекты размерного квантования обеспечивают асимметричный провал ВФХ при больших отрицательных и положительных напряжениях. Асимметрия связана с тем, что электроны имеют меньшую эффективную массу и, следовательно, бо́льшую длину волны де Бройля, чем дырки (50). Поэтому эффекты размерного квантования более существенны для электронов. Это выражается в большем провале ВФХ при положительных напряжениях, чем при отрицательных.

Вольт-фарадные характеристики *n*-германия представлены на рис. 2, *b* и рис. 3, *b*. В обоих случаях присутствует асимметричный провал квантовой емкости со смещением минимума в область двумеризации неосновных носителей заряда. Как показали расчеты, для *p*-германия такое смещение больше, чем для *n*-германия. Это связано с различием эффективных масс электронов и дырок и различием их длин волн де Бройля (50). Во всех рассмотренных случаях наблюдается хорошее согласие квантовой ВФХ с классической вблизи $V_S = 0$. Этот эффект является спецификой легированных пленок.

Заметим, что при $L < L_{\perp}^{-}$ согласно (53) условие применимости зонной модели твердого тела (52) выполняется плохо. Поэтому рис. З носит иллюстративный характер. На качественном уровне он показывает тенденции в ВФХ пленки при уменьшении ее толщины.

6. Заключение

В данной работе предложена быстрая схема квантового самосогласованного расчета ВФХ полупроводниковой пленки в случае омического контакта на тыльной стороне. Повышение его скорости и устойчивости достигается за счет следующих решений:

 расчет уровня Ферми на основе уравнения электронейтральности без самосогласования (18);

— при каждом значении поверхностного потенциала V_S индивидуальный расчет для электронов и дырок только тех уровней энергии, которые существенно влияют на заряд в ОПЗ (21);

 выход из самосогласованной процедуры при достижении заданной точности расчета поверхностной плотности заряда в ОПЗ (24);

— расчет уровней энергии на основе метода стрельбы для задачи Коши (40) с учетом правила формального смещения границы пленки (38), с применением алгоритма Верле в скоростной форме (43), (44) на сетке с постоянным шагом;

— локализация уровней энергии на основе параболической экстраполяции (47).

Предложенный подход проиллюстрирован расчетом поверхностной дифференциальной емкости германиевой пленки. В работе проведен сравнительный анализ результатов с расчетами в рамках феноменологической модели ОПЗ. Он показал, что провал ВФХ с уменьшением толщины пленки — существенно классический эффект вплоть до толщин порядка длины волны де Бройля носителей заряда. Квантовый самосогласованный расчет выявил дальнейший провал емкости, в том числе асимметричный провал, в области больших напряжений и смещение минимума ВФХ легированных полупроводников в область двумеризации неосновных носителей заряда.

Наличие этих эффектов в результатах эксперимента может говорить о размерном квантовании носителей заряда в полупроводнике. Асимметричный провал по краям ВФХ следует учитывать для корректного определения толщины диэлектрика при измерениях поверхностной дифференциальной емкости МДП структур. Работа выполнена при поддержке МНТЦ, грант № 3963.

Список литературы

- [1] О.В. Константинов, А.Я. Шик. ЖЭТФ, 58, 1662 (1970).
- [2] F. Stern. J. Comput. Phys., 6, 56 (1970).
- [3] F. Stern. Phys. Rev. B, 5, 4891 (1972).
- [4] F. Stern. Crit. Rev. Sol. St. Sci., 4, 499 (1974).
- [5] I.A. Pals. Phil. Res. Rep. Suppl., 7, 84 (1972).
- [6] Т. Андо, Ф. Фаулер, Ф. Стерн. Электронные свойства двумерных систем (М., Мир, 1985).
- [7] В.Н. Овсюк. Электронные процессы в полупроводниках с областями пространственного заряда (Новосибирск, Наука, 1984).
- [8] A. Yafyasov, I. Ivankiv. Phys. Status Solidi B, 208 (1), 41 (1998).
- [9] A.M. Yafyasov, I.M. Ivankiv, V.B. Bogevolnov. Appl. Surf. Sci., 142, 629 (1999).
- [10] L. Wang, P.M. Asbeck, Y. Taur. Sol. St. Electron., 54 (11), 1257 (2010).
- [11] M.T. Edmonds, C.I. Pakes, L. Ley. Phys. Rev. B, 81 (8), 085 314 (2010).
- [12] H. Garret, W.H. Brattain. Phys. Rev., 99 (2), 376 (1955).
- [13] J.H. Davies. *The physics of low-dimensional semiconductors* (Cambridge, Cambridge University Press, 1998).
- [14] Р. Кингстон, Э. Нейштадтер. В кн.: Проблемы физики полупроводников, под ред. В.Л. Бонч-Бруевича (М., ИЛ, 1957).
- [15] Д.Е. Цуриков, А.М. Яфясов. ФТП, 44 (10), 1336 (2010).
- [16] Н.Н. Калиткин. Численные методы (М., Наука, 1978).
- [17] А.С. Давыдов. Квантовая механика (М., Наука, 1973).
- [18] G. Masini, L. Colace, G. Assanto. Mater. Sci. Eng. B, 89, 2 (2002).
- [19] L. Palesi. J. Phys. Condens. Matter, 15, 1169 (2003).
- [20] M. Levinshtein, S. Rumyantsev, M. Shur. Handbook Series on Semiconductor Parameters (Word Scientific, 1996) v. 1.

Редактор Л.В. Шаронова

Quantum self-consistent calculation of the differential capacitance of a semiconductor film

D.E. Tsurikov, A.M. Yafyasov

Saint-Petersburg State University, 198504 St. Petersburg, Russia

Abstract A fast scheme for calculating the surface differential capacitance of a semiconductor film with an ohmic contact on the back side is proposed within self-consistent solving Schrödinger's and Poisson's equations. The method is considered by the example of a germanium. A comparison with phenomenological calculation results has disclosed the specific character of a quantum-confinement effects influence on the capacitance–voltage characteristic of the film.